

... Record (Refer to the List of Cited Documents for the Cited Documents)

Claims 1-6 Citations 1, 2
Remarks

Refer to Actual example 2 of Citation 1.

Further, the application of a liquid crystal cell manufacturing process to a general coating method (for example, refer to Citation 2) instead of [that used in] the actual example is simple for one skilled in the art.

For Claims 5, 6

The relative value of the initial average side method of the spacers for the cell gaps in Actual Example 2 of Citation 1 is approximately 107%.

List of Cited Documents

Citation 1:

Publication of Japanese Laid-Open Patent No. H6-160865
Publication of Japanese Laid-Open Patent No. S64-54420

...

2/2

...

•Prior Art References

Publication of Japanese Laid-Open Patent No. H2-123324
Publication of Japanese Laid-Open Patent No. H8-304841
Publication of Japanese Laid-Open Patent No. H11-264987

This prior art reference search result record is without the formation of rejection reasons.

整理番号 74610616

発送番号 199353

発送日 平成14年 6月25日 1 / 2

拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願2001-144565
起案日	平成14年 6月18日
特許庁審査官	右田 昌士 9513 2X00
特許出願人代理人	京本 直樹(外 2名) 様
適用条文	第29条第2項

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

請求項1-6 引例1, 2

備考

引例1の実施例2を参照。

なお、該実施例に代えて一般的な塗布法(例えば引例2を参照)による液晶セル製造工程を採用することは、当業者にとって容易である。

請求項5, 6について

引例1の実施例2において、セルギャップに対するスペーサの初期平均寸法の相対値は約107%である。

引用文献等一覧

引例1：特開平6-160865号公報

引例2：特開昭64-54420号公報

なお、この拒絶理由に不明な点がある場合、又は、この案件について面接を希望する場合は、審査第二部光デバイス(光制御) 右田(特許庁内線3293)までご連絡下さい。

発送番号 199353

発送日 平成14年 6月25日 2 / 2

先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野 IPC第7版 G02F1/1339

・先行技術文献 特開平2-123324号公報
特開平8-304841号公報
特開平11-264987号公報

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。